科学研究費助成事業

研究成果報告書

科研費

平成 27 年 6 月 10 日現在

機関番号: 1 4 3 0 1
研究種目: 基盤研究(B)
研究期間: 2012 ~ 2014
課題番号: 2 4 3 1 0 0 8 0
研究課題名(和文)イオン・陽電子同時照射系を用いるトランジェント陽電子計測法の開発
研究課題名(英文)Development of a transient positron measurement system using ion-positron simultaneous irradiation
研究代表者
木野村 淳(Kinomura, Atsushi)
京都大学・原子炉実験所・教授
研究者番号:9 0 2 2 5 0 1 1
交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 14,100,000円

研究成果の概要(和文): イオン照射で形成される欠陥を照射と同時に陽電子寿命測定ができるイオン・陽電子複合 ビーム分析装置の開発を行った。パルスイオンビームと、電子リニアックで発生するパルス低速陽電子ビームのタイミ ングを変えて照射し、20µsの時間幅で、陽電子寿命測定できるシステムを構築した。このシステムを用いて、酸化Si 試料や純金属試料に対する同時照射実験を行った。純Ni試料に対する実験では、表面からの陽電子再放出を調べること で、イオン照射誘起欠陥の過渡変化を観測できることが示された

研究成果の概要(英文): Ion-positron dual-beam analysis system for in-situ detection of ion-irradiation induced defects was developed. The developed system made it possible to perform positron lifetime measurements with a time window of 20 microsecond under synchronized irradiation of pulsed ion beams and electron-linear-accelerator based positron beams. Dual beam irradiation experiments were performed for Si oxide and pure metal samples by using this system. The experiments for pure Ni samples indicated that the transient change of ion-irradiation induced defects can be detected from positrons re-emitted from the surface.

研究分野:ビーム応用、照射効果

キーワード: 陽電子 イオン照射 照射損傷 その場分析

1.研究開始当初の背景

中性子やイオンなど高エネルギー粒子に よる材料の照射損傷の基礎過程を理解する ための有力な手段として、損傷導入と同時に 測定を行うためのその場測定法の研究が行 われてきた。イオン加速器と結合した透過型 電子顕微鏡をはじめ、様々なタイプの装置が 開発され、その延長線上で、イオン加速器結 合型の陽電子計測装置が提案された。2004 年には、バンデグラーフ加速器からの MeV イオンビームと ²²Na 線源から得られた低速 陽電子ビームを同時照射し、陽電子ドプラー 拡がりその場測定を行う装置が東大から発 表された。陽電子計測は原子レベルの微細な 空孔が検出できる有力な方法であり、透過電 子顕微鏡で検出できないサイズの原子空孔 を検出できる可能性がある。一方で、上記の システムに用いられたドプラー拡がり測定 では、空孔サイズを直接見積もることが困難 である。このため産業技術総合研究所(産総 研)では、空孔サイズの直接測定が可能な陽 電子寿命測定とイオン照射を組み合わせた 複合ビーム分析装置の開発を行ってきた。

2.研究の目的

産総研で開発されたその場分析装置では、 陽電子源として電子直線加速器(電子リニア ック)が用いられたが、従来、陽電子源とし て加速器を用いる目的は、高強度の陽電子ビ ームを得るためであった。本研究では、電子 リニアックを高強度陽電子源というよりパ ルス陽電子源として考え、イオン・陽電子同 時照射を用いた照射誘起欠陥の時間分解測 定を行うことを目指した。すなわち、パルス イオンビームとパルス陽電子ビームを同期 して固体材料に照射し、その二つのビームの 照射タイミングを制御することにより、照射 誘起欠陥の過渡的な状態の測定を可能にす ることが本研究の目的である。

3.研究の方法

(1) 電子リニアックベースの低速陽電子ビ ームラインでは、陽電子はマイクロ秒オーダ ーの時間幅のパルスとして得られる。これを そのまま試料チャンバーに送っても、短時間 に集中的に陽電子消滅イベントが発生する ため、アナログ式時間波高分析回路では信号 が飽和して追随できない。このため、従来の システムでは、リニアストレージで陽電子蓄 積とパルスストレッチを行う必要があった。 一方、本研究のシステムでは、高速波形デジ タイザで陽電子消滅信号を一括して取り込 み、パソコン上で波形解析を行うことにより 陽電子寿命スペクトルを得る。この方法によ り、数 10 マイクロ秒オーダーの時間分解測 定が実現できる。本研究では、損傷導入用の イオンビームもチョッパーでパルス化して、 陽電子の照射タイミングと同期することに より、損傷状態の変化を時間分解測定できる システムを開発した。

(2) さらにリニアックで発生した陽電子パ ルスのパルス幅を制御する技術として、リニ アストレージ及びインダクションバンチャ ーを導入し陽電子パルス幅可変装置として の可能性を検討した。また損傷導入用のイオ ン加速器としては、最大加速電圧150kVの中 エネルギー加速器と最大加速電圧3kVの低エ ネルギー加速器の2種類を使用して装置の拡 張性について評価した。図1にこれらのビー ムラインの構成要素を示す。



図1 ビームライン構成要素

(3) 測定対象試料として、金属試料(純 Ni および純 Fe)と酸化 Si 試料(熱酸化 Si およ び溶融石英)を用いた。純金属試料は陽電子 寿命と格子欠陥の関係が良く調べられてお り、酸化 Si については、ポジトロニウムが 形成され、ポジトロニウム強度が各種の放射 線損傷に依存することが分かっていること から、本研究の測定試料として選択した。

4.研究成果

(1) イオン・陽電子複合ビーム分析装置の開 発として高速波形デジタイザと周辺回路の 制御ソフトウェアの開発を行った。従来バル ク陽電子消滅寿命測定に高速波形デジタイ ザやデジタルオシロスコープが使われた例 があったが、バルク測定では離散的に常に信 号が発生するのに対し、本研究のリニアック ベースのシステムの場合、消滅ガンマ線の信 号は約 20 µs の間に集中して発生する。こ れを逃すことなく捕捉収集するため、電子リ ニアックの電子パルス発生を制御するマス ターパルスに同期して高速波形デジタイザ を動作させる方法を取った。図2にそのよう にして捕捉されたガンマ線消滅信号(BF,シン チレーション検出器の光電子増倍管出力信 号)を示す。



図 2 高速波形デジタイザに捕捉された消 滅ガンマ線信号。

実際の測定ではデータ取得のためのウィ ンドウ幅を 20 μs に設定し、サンプリング レートを装置最速の4GS/s(データ点の間隔 250 ps)として出来る限り高精度に信号を収 集するようにしている。また、ガンマ線消滅 信号と同時に陽電子のチョッパー信号を記 録してそのピークの時間差から陽電子の消 滅時間を計算している。波形解析をリアルタ イムで行うため、データ処理プログラムとし て C++言語で記述されコンパイルされたコー ドを使用している。そして陽電子寿命スペク トルの時間分解能と、ピークバックグラウン ド比ができるだけ短くなるようにプログラ ムの最適化を行った。その結果、陽電子寿命 スペクトルの時間分解能として 0.30 ns が得 られた。測定スペクトルの例として、Si 基板 上の厚さ 0.5 µm の熱酸化 Si 膜(Si0,層)を エネルギー3 keV の陽電子ビームで測定した 結果を図3に示す。実線はスペクトル解析ブ ログラムによるフィッティング結果である。



図 3 Si 基板上の熱酸化 Si 膜の陽電子寿命 スペクトル。

開発された分析システムではイオンビー ムもチョッパー電極を用いてパルス化して 試料に照射することが可能である。照射誘起 欠陥の時間分解測定を行うため、電子リニア ックで発生する陽電子ビームと同期してイ オンビーム照射を行うための機能を制御プ ログラムに取り入れた。図4はイオンビーム と陽電子ビームを同期して照射した例を示 している。図4では#1(イオンビームパルス の中央)と#2(イオンビームパルス中央から 0.5 µs後)に設定した例を示している。こ こではイオンビームに対して陽電子ビーム のタイミングを変えた形で表示しているが、 実際には、陽電子ビームの照射時間は一定間 隔であるため、イオンビームの照射時間の方 を変えている。陽電子消滅信号は幅 20 μs の時間ウィンドウの中で測定しているため、 このウィンドウ幅に相当した精度で、ポンプ プローブ的な測定が可能であることが示さ れた。すなわちイオンビーム照射で欠陥を誘 起(ポンプに対応)し、陽電子寿命測定(プ ローブに対応)が実現できる。

制御プログラムでは、試料や照射条件に応 じて、短周期と長周期の二つのモードが使え るようにした。短周期モードでは、イオンビ ームのパルス1回に対し、陽電子ビームのパ ルスが1回来るようにする。この場合、対象 となる過渡変化の時間範囲は陽電子ビーム のパルス間隔(例えば50 ppsの場合20ms) より短いものとなる。長周期モードでは、イ オンビームパルスが1回来た後に、複数回の 陽電子ビームパルスで測定を続ける。この場 合には、対象となる過渡変化の時間範囲は、 陽電子ビームのパルス間隔よりも長いもの となる。

陽電子のパルス幅制御を目的として、陽電 子ビームラインに陽電子蓄積用ストレージセ クションを挿入した。陽電子の蓄積をしない 場合、試料上での陽電子パルス幅は約20µs であるが、数10µsオーダーの短時間の蓄積を 行なった結果、パルス幅が40µsに拡がり、陽 電子蓄積用ストレージセクションが陽電子パ ルス幅制御にも使えることが示された。さら にインダクションバンチャーによる陽電子パ ルス制御装置による実験を行った。計算によ り求めた高周波変調波形とバイアス電圧をイ ンダクションバンチャーに印加し、試料上に 到達する陽電子の時間構造を調べた。その結 果、連続的な陽電子ビームを、半値幅約50ns のパルスに圧縮することができた。



図4 イオンビームと陽電子ビームの同期照 射の例。

(2) 本研究ではイオンビーム照射下の照射 誘起欠陥の過渡的な変化を観測することを 目指している。その第一段階として、イオン ビーム照射時と非照射時の差を見ることが 重要である。このため、シリコン上の熱酸化 膜と純 Fe に対する Ar イオンと陽電子の照射 実験を行った。図5はSi基板上の熱酸化Si 膜に対する実験結果を示す。 横軸は Ar のイ オンの照射量で、縦軸は熱酸化 Si (Si 0,)の 陽電子寿命スペクトルを取った時に観測さ れる o-Ps(オルソポジトロニウム)成分の強 度である。一回目の照射から o-Ps 強度が顕 著に低下し、やがて一定レベルに飽和する傾 向が観測された。実験では照射(ON)と非照射 (OFF)を交互に繰り返したが、ON 状態と OFF 状態の間で有為な差は見られていない。図 6 は純 Fe に対して同様の実験を行った結果で ある。この場合、グラフの縦軸は平均陽電子 寿命である。平均陽電子寿命は照射量が増え るとともに減少するが、減少は一定の値で飽 和する。これは未照射時には表面の寿命が反 映し、欠陥の導入とともに陽電子の拡散距離 が低下して、表面の影響が出なくなったため と解釈できる。この図の場合も照射と非照射 を交互に繰り返したが、ON 状態と OFF 状態の 間で有意な差が出なかった。



図5 イオンビーム照射下における熱酸化 Si 膜のポジトロニウム強度の変化。



図 6 イオンビーム照射下における純 Fe の平 均陽電子寿命の変化。

図5と図6に示す実験はいずれも室温で行 われた。室温では照射で誘起される点欠陥の 拡散や回復の速度が小さく、欠陥の過渡的な 挙動の観測は困難であると考えられる。この ため、試料を室温以上に加熱し、600 まで の範囲で照射実験を行った。様々な実験条件 の中で、欠陥の過渡的挙動が顕著に観測され た例を図7に示す。純Ni 試料に対して500 で Ar イオン照射し、その際に試料表面近傍 のポテンシャル分布を周辺の電極とそのバ イアス電圧で制御した。この時、図7に見ら れように、主ピークから 5 ns 遅れた時間に サテライトピークが観測された。このサテラ イトピークはバイアス電圧に対する応答や、 陽電子軌道シミュレーションより、表面から 再放出された陽電子が試料に再入射した際 に生じる消滅ガンマ線によるものと判断さ れた。イオン照射を行いながらこのサテライ トピークの強度を調べると、照射でいったん 強度低下するが、照射をやめると強度が回復 する傾向を示した。これは表面近傍に形成さ れて照射誘起欠陥が表面再放出陽電子の量 を減らすものの、照射をやめると欠陥の回復 により、再放出陽電子の量が増えるものと考 えられる。この様な形で照射誘起欠陥の過渡 的な変化が観測できることが本研究により 初めて示された。さらに、イオンビーム照射 を止めた後に複数回陽電子寿命測定を続け ることにより、過渡的変化の時定数を調べる ことができた。実際に、図7の照射条件では

683 秒という値が得られた。また石英試料の 損傷導入速度の温度依存性を調べることに より、損傷形成の活性化エネルギーを調べる ことが可能であることも示された。



図7 純 Ni に対する Ar イオン照射で観測され た再放出ピークとその過渡変化。

5.主な発表論文等

(研究代表者、研究分担者及び連携研究者に は下線)

〔雑誌論文〕(計 3件)

A. Kinomura, R. Suzuki, N. Oshima, B.E. O'Rourke, T. Nishijima and H. Ogawa, Digitized Detection of Gamma-Ray Signals Concentrated in Narrow Time Windows for Transient Positron Annihilation Lifetime Spectroscopy, Rev. Sci. Instrum., 查読有, 85 (2014) 123110-1 - 123110-5 DOI: 10.1063/1.4903754 <u>木野村淳</u>、岩井岳夫、<u>土田秀次</u>、陽電子 ビームによる照射損傷その場分析装置の 開発と応用、陽電子科学,査読有,3号 (2014) 27-36 http://positron-science.org/kaiho/3. html <u>A. Kinomura, R. Suzuki, T. Ohdaira, N.</u> Oshima, B.E. O'Rourke and T. Nishijima, In-situ positron lifetime spectroscopy of radiation damage by simultaneous irradiation ٥f

Conf. Ser., 査読有, 443 (2013) 012043-1 - 012043-4

slow-positron and ion beams, J. Phys.:

DOI: 10.1088/1742-6596/443/1/012043

[学会発表](計25件) 水野翔平、堤弘法、<u>木野村淳、鈴木良</u> 一、<u>土田秀次</u>、伊藤秋男、パルス陽電 子によるイオン損傷熱緩和の時間分解 解析、日本物理学会春季大会、2015年 3月21日、早稲田大学早稲田キャンパ ス(東京都新宿区) 水野翔平、堤弘法、<u>木野村淳、鈴木良</u> 一、間嶋拓也、今井誠、斉藤学、<u>土田</u> <u>秀次</u>、伊藤秋男、陽電子を用いたイオ ン照射効果の時間分解解析、フォーラ ム21-イオンビームを用いた物理とそ の応用-、2015年1月10日、大阪教育 大学天王寺キャンパス(大阪府大阪市) H. Tsuchida, S. Mizuno, H. Tsutsumi, A. Kinomura, R. Suzuki and A. Itoh, Real-time observation of thermal relaxation of ion damage by synchronized positron probe analysis, 第15回「イオンビームによる表面・界 面解析」特別研究会, 2014 年 12 月 6 日、筑波大学研究基盤総合センター(茨 城県つくば市) <u>木野村淳、鈴木良一</u>、<u>大島永康、B.E.</u> <u>0'Rourke</u>、 西島俊二、<u>小川博嗣、土田</u> <u>秀次</u>、イオン・陽電子複合ビーム照射 における表面再放出と陽電子寿命の比 較検討、京大原子炉専門研究会「陽電 子科学とその理工学への応用、2014 年 11 月 29 日、京都大学原子炉実験所 (大阪府熊取町) <u>木野村淳、鈴木良一、大島永康、B.E</u> <u>O'Rourke</u>、 西島俊二、小川博嗣、土田 <u>小川博嗣、土田</u> 秀次、イオン・陽電子複合ビーム照射 で検出されたNiの照射損傷の過渡変化、 日本金属学会 2014 年秋期講演大会、 2014年9月26日、名古屋大学東山キャ ンパス(愛知県名古屋市) S. Mizuno, H. Tsutsumi, H. Tsuchida, A. Kinomura, R. Suzuki and A. Itoh, Observation of dynamic relaxation processes of ion damage in fused quartz, The International Workshop on Positron Studies of Defects 2014 (PSD-14), 2014年9月16日, 京都大学 吉田キャンパス(京都府京都市) <u>A. Kinomura, R. Suzuki, N. Oshima,</u> B.E. O'Rourke, T. Nishijima, H. Ogawa Tsuchida, and Η. Transient Measurement of Irradiation Damage by In-Situ Positron Lifetime Spectroscopy, The International Workshop on Positron Studies of Defects 2014 (PSD-14) (招待講演), 2014年9月18日,京都大学吉田キャン パス(京都府京都市) 水野翔平、堤弘法、土田秀次、木野村 <u>淳、鈴木良一</u>、伊藤秋男、パルス陽電 子プローブによる石英ガラスの照射損 傷の緩和時間測定、日本物理学会 2014 年秋季大会、2014年9月7日、中部大 学春日井キャンパス(愛知県春日井市) <u>木野村淳、鈴木良一、大島永康、B.E.</u> <u>O'Rourke</u>、 西島 俊二、<u>小川博嗣</u>、<u>土田</u> <u>____</u> 秀次、イオン・陽電子複合ビーム照射 における陽電子寿命と再放出の測定、 第 51 回アイソトープ・放射線研究発表 会、2014 年 7 月 8 日、東京大学弥生講 堂(東京都文京区) <u>木野村淳、鈴木良一</u>、<u>大島永康、B.E.</u> <u>O'Rourke</u>、 西島俊二、<u>小川博嗣、土田</u> 秀次、イオン陽電子複合ビーム照射に

おける照射タイミングと陽電子寿命ス ペクトルの変化、日本金属学会 2014 年 春期講演大会、2014 年 03 月 21 日、東 京工業大学大岡山キャンパス (東京都 目黒区) <u>A.Kinomura, R. Suzuki, N</u>. Oshima, B.E. O'Rourke, T. Nishijima, H. Ogawa and H. Tsuchida, Dual beam analysis for in-situ positron svstem annihilation spect roscopy of ion-irradiation induced defects. Japan-China Joint Workshop on Positron Science (招待講演), 2013 年12月21日,産業技術総合研究所つ くばセンター(茨城県つくば市) <u>木野村淳、鈴木良一、大島永康、B.E.</u> <u>O'Rourke</u>、 西島俊二、<u>小川博嗣、土田</u> 秀次、イオン・陽電子複合ビーム分析 装置の開発と照射損傷その場分析、第 14回「イオンビームによる表面・界面 解析」特別研究会(招待講演) 2013 年 12 月 14 日、神奈川大学横浜キャン パス(神奈川県横浜市) <u>木野村淳、鈴木良一</u>、小林慶規、義家 敏正、徐虫L、佐藤紘一、陽電子計測で 得た金属中のイオン照射損傷分布と計 算及び TEM 観察との比較、京都大学原 子炉実験所ワークショップ「材料照射 効果と応用」、2013年12月13日、京都 大学原子炉実験所(大阪府熊取町) <u>木野村淳、鈴木良一、大島永康、B.E.</u> <u>O'Rourke</u>、西島俊二、<u>小川博嗣、土田</u> <u>秀次</u>、陽電子再放出に着目したイオ ン・陽電子複合ビームによるその場分 析、京都大学原子炉実験所専門研究会 「陽電子科学とその理工学への応用」、 2013 年 12 月 7 日、京都大学原子炉実験 所(大阪府熊取町) A. Kinomura, R. Suzuki, T. Ohdaira, N. Oshima, B. E. O'Rourke, T. Nishijima and H. Tsuchida, Positron lifetime spectroscopy of radiation damage by synchronized ion and slow-positron irradiation. 13th International Workshop on Slow Positron Beam Techniques and Applications (SLOPOS13), 2013 年 9 月 16 日, Technische Universitaet Muenchen (Muenchen, Germany) H. Tsuchida, A. Kinomura, H. Tsutsumi, R. Suzuki and A. Itoh, Thermal stability of radiation defects in fused quartz under ion irradiation studied by real-time observations of positron lifetime spectra, 13th International Workshop on Slow Beam Techniques Positron and Applications (SLOPOS13), 2013 年 9 月 16 日, Technische Universitaet Muenchen (Muenchen, Germany)

<u>木野村淳、鈴木良一、大平俊行、大島</u> 永康、B.E. O'Rourke、西島俊二、小川 博嗣、パルスイオンビーム照射に同期 した照射損傷のその場陽電子寿命測定、 第50回アイソトープ・放射線研究発表 会、2013年7月4日、東京大学弥生講 堂(東京都文京区) 金古岳史、林崎規託、<u>大島永康、</u>木野 村淳、B.E. O'Rourke、鈴木良一、筒井 拓朗、木村彰吾、渡邊智仁、上殿明良、 インダクションバンチャーを用いた高 効率陽電子ビームパルス化システムの 開発、日本物理学会第 68 回年次大会、 2013年3月29日、広島大学東広島キャ ンパス (広島県東広島市) <u>木野村淳、鈴木良一、大平俊行、大島</u> 永康、B.E. O'Rourke、西島俊二、小川 博嗣、イオンビーム照射下で測定され たその場陽電子寿命スペクトルの変化、 日本金属学会 2013 年春期講演大会、 2013年3月28日、東京理科大神楽坂キ ャンパス(東京都新宿区) <u>木野村淳、鈴木良一、大平俊行、大島永</u> 康、Brian E. O'Rourke、西島俊二、小川 博嗣、イオン・陽電子同時照射実験で得 られたその場陽電子寿命スペクトルに関 する考察、京都大学原子炉実験所ワーク ショップ「材料照射効果と応用」、2012 年12月15日、京都大学原子炉実験所(大 阪府熊取町) 21 木野村淳、鈴木良一、大平俊行、大島永 康、B.E. O'Rourke、西島俊二、小川博嗣、 電子・イオン複合ビーム分析装置の測定 系について、京都大学原子炉実験所専門 研究会「陽電子科学とその理工学への応 用」、2012年11月30日、京都大学原子 炉実験所(大阪府熊取町) 22 A. Kinomura, R. Suzuki, T. Ohdaira, N. Oshima, B. E. O'Rourke and T. Nishijima, In-Situ Analysis System to Detect Vacancy-Type Defects during Ion Beam Irradiation, 8th Internation Symposium on Swift Heavy lons in Matters, 2012 年 10 月 24 日, 京都大学 吉田キャンパス(京都府京都市) 23 木野村淳、鈴木良一、大平俊行、大島永 康、<u>B.E. O'Rourke</u>、西島俊二、パルスビ ームによる陽電子寿命測定を用いたイ オン照射損傷その場分析、日本金属学会 2012年秋期大会、2012年9月18日、愛 媛大学 (愛媛県松山市) A. Kinomura, R. Suzuki, T. Ohdaira, N. Oshima, B.E. O'Rourke and T. Nishijima, positron In-situ lifetime spectroscopy of radiation damage by

In-situ positron lifetime spectroscopy of radiation damage by simultaneous irradiation of slow-positron and ion beams, 16th International Conference on Positron Annihilation (ICPA-16), 2012 年 8 月 20, University of Bristol (Bristol, UK)

25 <u>木野村淳、鈴木良一、大平俊行、大島永</u> <u>康、B.E. 0'Rourke</u>、西島俊二、パルス陽 電子ビームによるイオン照射損傷のそ の場分析、第 49 回アイソトープ・放射 線研究発表会、2012 年 7 月 10 日、東京 大学弥生講堂(東京都文京区)

〔その他〕

- ホームページ等
- https://www.aist.go.jp/aist_j/aistinfo/ aist_today/vol14_09/vol14_09_main.html

6.研究組織

- (1)研究代表者
 木野村 淳 (KINOMURA, Atsushi)
 京都大学・原子炉実験所・教授
 研究者番号:90225011
- (2)研究分担者

大島 永康 (OSHIMA, Nagayasu) 産業技術総合研究所・計測フロンティア研 究部門・主任研究員 研究者番号:00391889

(3)研究分担者
 オローク ブライアン(O'Rourke, Brain E.)
 産業技術総合研究所・計測フロンティア研究部門・主任研究員
 研究者番号:60586551

- (4)研究分担者
 鈴木 良一 (SUZUKI, Ryoichi)
 産業技術総合研究所・計測フロンティア研究部門・首席研究員
 研究者番号: 80357300
- (5)研究分担者
 小川 博嗣 (OGAWA, Hiroshi)
 産業技術総合研究所・計測フロンティア研
 究部門・主任研究員
 研究者番号: 60356699
- (6)連携研究者
 大平 俊行 (OHDAIRA, Toshiyuki)
 産業技術総合研究所・計測フロンティア研
 究部門・主任研究員
 研究者番号:90356642

(7)連携研究者
 土田 秀次 (TSUCHIDA, Hidetsugu)
 京都大学・工学(系)研究科(研究院)・
 准教授
 研究者番号: 50304150

西島 俊二 (NISHIJIMA, Toshiji)